

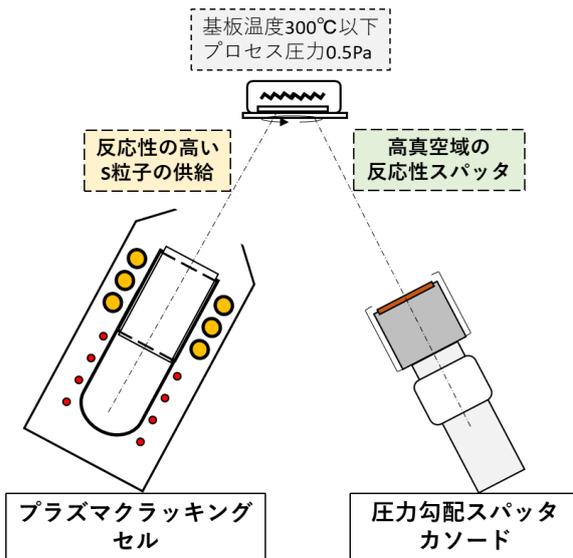
層状構造を有する硫化物半導体の新しい作成プロセスのご紹介

蒸気圧の高いカルコゲン（硫黄、セレン）の成膜に困っていませんか？
スパッタリング中の薄膜へのプラズマダメージに困っていませんか？

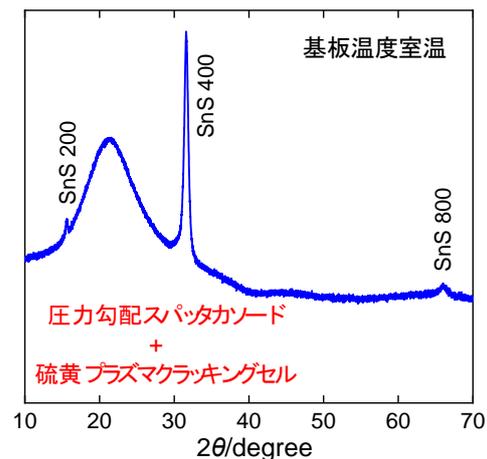
- プラズマクラッキングセルによる
反応性の高い硫黄粒子の生成
- 圧力勾配スパッタによる 高真空反応性スパッタ

硫黄欠損の低減・低温形成・高い結晶性 を確認

構造概要



XRD 評価データ



室温の基板の上に結晶性の高い
SnS 薄膜が得られました

3月23日（土曜日）12:15~12:55

【お弁当付きです！】

ランチョンセミナー会場：1BN（1号館）

皆さまに支えられ **Kenix** は創業 17 年目となりました。ありがとうございます。

これからも変わらぬご支援、よろしくお願いいたします。

*東北大学 多元研
鈴木一誓先生にも
登壇いただきます。